

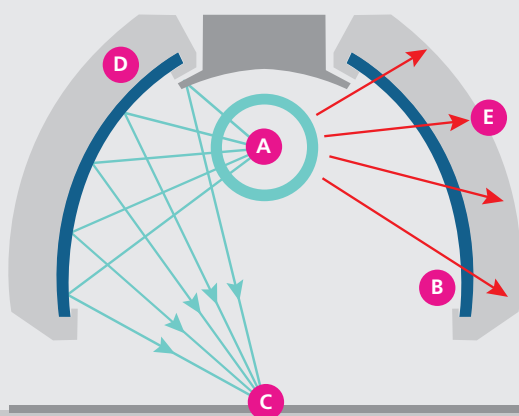
E2C[®]UV

Sistema de curado

El sistema UV de baja energía más potente para prensas de impresión de banda estrecha



Cabezal de lámpara E2C UV



- A Lámpara de alta potencia
- B Pérdida mínima de reflector
- C Perfil de radiación UV con ajuste óptico
- D Enfriamiento de reflector activo
- E Absorbe el calor

ArcLED® tecnología UV híbrida

ArcLED permite el uso de una lámpara de arco UV convencional o una matriz LED en la misma unidad de impresión. Tanto los casetes de arco como las LED son compatibles con la misma fuente de alimentación y encajan en la misma unidad de impresión facilitando el cambio.

El control RHINO permite que se utilice cualquier combinación de tecnologías de curado en la misma prensa.

Tecnología UV preparada para el futuro

ArcLED permite que la impresora cambie entre el curado por arco y LED a voluntad para adaptarse a los requisitos del proceso y la dosificación de la tinta.

Los sistemas GEW de arco y LED se pueden actualizar en el campo a la solución híbrida o suministrarse en esta configuración desde el principio.



Curado UV GEW E2C

- Versátil, controlable y seguro para la gama más amplia de materiales sensibles al calor
- Tecnología de obturador refrigerado por aire patentado
- Sin transferencia de calor a la máquina o sustrato en estado de reposo
- Los reflectores de ajuste óptico aprovechan al máximo el efecto de curado de la lámpara
- La refrigeración por aire es ahora más efectiva que la refrigeración por agua
- Compatible con las mayores velocidades de impresión
- Dosis más alta + Intensidad más alta = curado máximo
- Listo para LED: teniendo una unidad de impresión híbrida, un casete LW2 LED y un casete de lámpara de arco E2C se pueden intercambiar en la misma unidad de impresión

Especificaciones

Potencia eléctrica máx.	140W / cm
Espectro	Mercurio**
Irradiación en el punto focal	5,8W / cm ² *
Dosis típica @ 100m / min	125mJ / cm ² *
Longitud máxima	60cm
Sección transversal estándar	110mm W x 190mm H
Refrigeración	Aire
Temperatura de funcionamiento estándar máx.	40°C (104°F)
Humedad estándar máx.	Sin condensación

*Medido en las condiciones del laboratorio estándar de GEW con una configuración estándar de cabeza de lámpara. ** Existen variables de lámpara disponibles bajo demanda.

Mantenimiento mínimo

- Diseñado para cambios de lámpara más rápidos y sencillos
- Todos los componentes reemplazables son de instalación automática para un mantenimiento sencillo
- La trayectoria del flujo de aire activa patentada reduce el consumo y la contaminación de la lámpara y los reflectores: se requiere menos limpieza para mantener el rendimiento del curado

Beneficios del sistema

Listo para LED

- Fácilmente se puede actualizar al curado UV LED en un futuro usando el mismo sistema de alimentación híbrido RHINO ArcLED

Mínimo costo total de propiedad

- Ahorro de energía del 45%
- Ahorra decenas de miles de Euros o Dólares durante la vida útil de su máquina
- Consumo de aire en la planta reducido

Medida de sostenibilidad fácilmente aplicable

- Reducción inmediata de la huella de CO₂
- Funcionamiento relajado y tranquilo sin necesidad de una costosa refrigeración de agua
- Elimina todo el consumo del aire de ambiente procesado con la opción de refrigeración NetZero

Garantía de 5 años

- Evita costos de mantenimiento imprevistos

Máxima productividad de la máquina

- Tecnología de inicio rápido de la lámpara
- El sistema evita proactivamente el tiempo de inactividad imprevisto
- Curado consistente de alta velocidad
- Instalación rápida

Disponible con curado de atmósfera inerte

- Permite la producción de protectores antiadherentes de silicón y envases de alimentos
- Consistencia del proceso asegurada con control del nivel de oxígeno de precisión integrado
- Soluciones totalmente diseñadas para adaptarse a su aplicación específica

Opciones

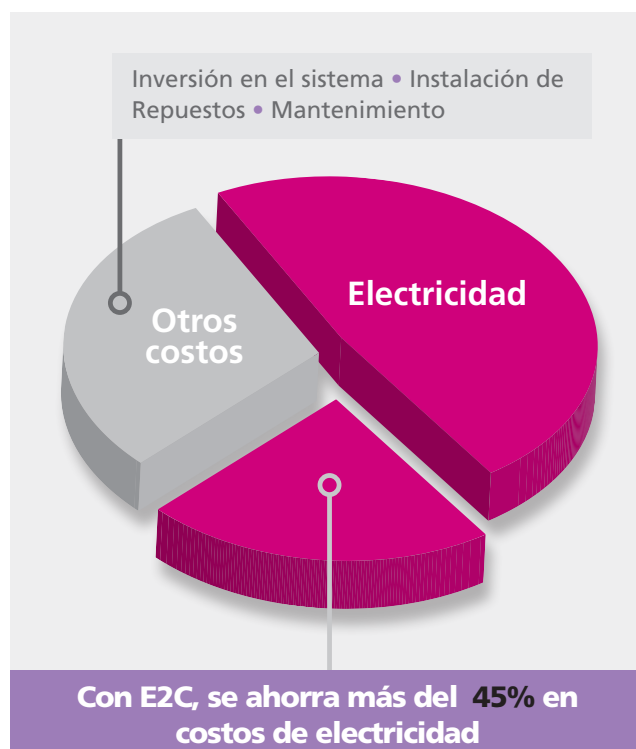
- Lámparas dopadas (Fe, Ga)
- Personalización para adaptarse a aplicaciones especializadas
- Monitoreo UV multipunto

¿Por qué usar GEW E2C?

Huella de carbono de 10 años y costos de electricidad para una solución UV de 16" de 8 lámparas

	EUROPA		EE. UU.	
	costo en euros	Toneladas de CO ₂	costo en dólares	Toneladas de CO ₂ *
Otro sistema UV	€235,500	800	\$242,000	1130
Sistema E2C UV	€128,000	440	\$131,500	620
AHORRO	€107,500	360	\$110,500	510

*Una huella de carbono más alta en EE. UU. se debe a un mayor uso de combustibles fósiles para generación eléctrica. Cálculos basados en los costos medios europeos y estadounidenses de 2019 y la huella de carbón por kWh de electricidad.



Potencia RHINO

Funcionamiento a prueba de fallos

El diseño electrónico militar protege el sistema UV de los daños provocados por voltajes incorrectos, conexiones a tierra, fases caídas, picos de tensión y rayos. En caso de una grave interrupción eléctrica, el sistema se desconectará en modo seguro.

RHINO está diseñado para ejecutar en las condiciones más duras a temperatura ambiente de hasta 40°C. El sistema no se ve afectado por el polvo, el rocío de tinta y otros contaminantes atmosféricos.

Mínimos costos operativos

Con la gestión energética inteligente, el consumo de corriente se mantiene balanceado y reduce al máximo la distorsión armónica, lo cual reduce la demanda de energía.

Huella mínima del soporte RHINO

Un armario compacto aloja sistemas de alimentación para hasta 6 lámparas y proporciona refrigeración, protección atmosférica y distribución perfecta de la corriente eléctrica.

Garantía de 5 años disponible

El paquete de servicio integrado de GEW le ofrece total confianza en la fiabilidad de los sistemas GEW y reduce los costos de mantenimiento imprevistos. GEW es el único proveedor UV que ofrece este nivel de garantía.

Máximo control



Pantalla táctil RHINO

Servicio integrado

El control RHINO está conectado a Internet y los datos de rendimiento del sistema encriptados se envían en directo a GEW 24/7.

Es lo que garantiza la respuesta más rápida y precisa a los problemas que pueden surgir en el sector.

Informes de rendimiento del sistema

Se generan informes regulares, detallando el uso de energía, el porcentaje de tiempo de actividad y el rendimiento del sistema.

El Registro de eventos deja constancia continuamente del uso del sistema y de los parámetros operativos, garantizando que el sistema está funcionando con la máxima eficiencia en todo momento.



Oficina central

GEW (EC) Limited, Crompton Way, Crawley RH10 9QR, Reino Unido

Reino Unido +44 1737 824 500 Alemania +49 7022 303 9769

Estados Unidos +1 440 237 4439

E sales@gewuv.com W gewuv.com